

3面露光マスクアライナー

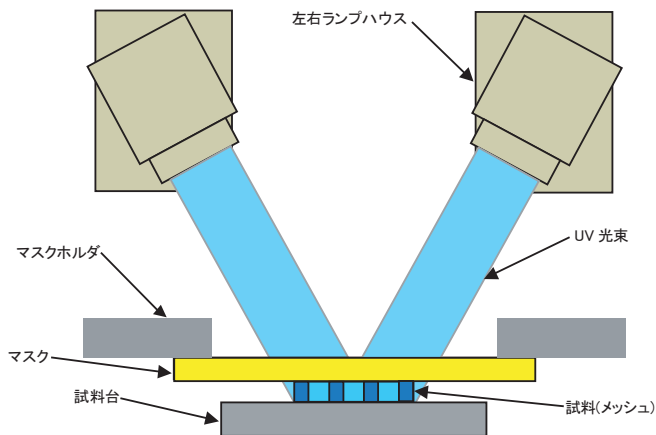
本装置は、半導体素子デバイス等フォトリソグラフィを必要とする研究分野において、各種パターン露光ができる露光装置です。本装置ではフライアイレンズ方式UV光源2灯にて試料表面および左右両側面への露光が可能です。特に水晶などデバイス側面にもパターン露光が必要なプロセスに向けてカスタマイズされています。シンプルな構成でカスタマイズ性に優れ多方面で応用が利くローコストなモデルです。



(改良のため仕様・意匠は変更されることがあります)

主な仕様

- ◆露光方式 1:1(等倍)コンタクト露光 試料表面および左右側面への露光実験に対応
- ◆適応試料 サイズ 最大φ4インチ(露光エリアはUV光源によって決まります) 厚さ 最大2mm
角形試料に対応します
- ◆適応マスク サイズ 最大□5インチ 厚さ 0.06インチまたは0.09インチ
- ◆ランプハウス 光学形式 フライアイレンズ、ダイクロミック楕円ミラー方式
斜光露光対応(水平より50度 左右対称)
使用ランプ 水銀キセノンランプ 200W 照射距離 約140mm
有効露光範囲 縦76.5mm×横76.5mm以上
波長域 $\lambda = 365 \sim 436\text{nm}$ 放射強度 約 $10\text{mW}/\text{cm}^2$ 以上(at 365nm) 照度均一度 $\pm 10\%$
- ◆アライメント方式 顕微鏡による目視アライメント マスク位置固定、試料移動型アライメント
- ◆顕微鏡 双眼双対物2視野顕微鏡(3倍率切替) 総合倍率 92.5 185 370 視野径(mm) $\phi 1.8 \phi 0.9 \phi 0.45$
※左右視野単眼としての横方向サイズは視野径の半分になります。
対物レンズ間距離 14(8)~90mm (最小対物レンズ間隔8mmはオプション)
観察照明 ハロゲンランプ+ファイバーライトガイドによる同軸落射照明
- ◆マスクアライメントステージ(マスク固定、ウェハ移動) XYZ θ 軸 微粗動ハンドル操作



- Z軸コンタクト 0~0.5mm エア駆動
ギャップ微動調整 レバー操作
レベル(水平)調整 球面摺動機構 真空ロック可能
- ◆マスク架台ヒンジ開閉式
- ◆観察位置ステージ XY軸ストローク $\pm 20\text{mm}$ 手動(レバー方式) オプション
- ◆寸法/重量 670(H)×700(W)×600(D)mm以内 / 80Kg 以下
- ◆ユーティリティ 電源 AC100V 10A 以下 (UV光源装置込み)
窒素またはドライエア $5\text{Kg}/\text{cm}^2$ 程度
真空 600mmHg以上

特約店
SANMEI GROUP IDENTITY

sanmei 株式会社 三明

〒424-0825 静岡県静岡市清水松原町6-16
電話 (0543)53-3271 Fax (0543)52-1648

製造元



株式会社 ナノテック
Nanometric Technology Inc.

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-5-8-201 電話 (03)3960-3171 Fax (03)3960-3174

www.nanotech-inc.co.jp
info@nanotech-inc.co.jp